Сведения о научном руководителе или научном консультанте

по диссертации Черкасова Александра Алексеевича «Сильноточный импульсный магнетронный разряд с инжекцией электронов из плазмы вакуумной дуги для осаждения покрытий и генерации ионных пучков» по специальности 2.2.1. – вакуумная и плазменная электроника на соискание ученой степени кандидата технических наук.

Фамилия, Имя, Отчество	Шандриков Максим Валентинович
Гражданство	Российская Федерация
Ученая степень (с указанием шифра специальности и отрасли науки, по которым защищена диссертация)	Кандидат технических наук 05.27.02 (Вакуумная и плазменная электроника)
Ученое звание (по кафедре или по специальности)	нет
Домашний адрес с индексом	634061, г. Томск, ул.Вавилова 10, кв.42 e-mail: shandrikov@opee.hcei.tsc.ru сотовый телефон +7(913-848-23-43)
Основное место работы	
Почтовый индекс, адрес, телефон, адрес электронной почты (при наличии), адрес официального сайта в сети интернет (при наличии)	634055, город Томск, пр. Академический, д.2/3. http://www.hcei.tsc.ru
Полное название организации в соответствии с уставом	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт сильноточной электроники Сибирского отделения Российской академии наук (ИСЭ СО РАН)
Наименование подразделения	Лаборатория плазменных источников
Должность	Старший научный сотрудник

Список основных публикаций научного руководителя (научного консультанта) по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние пять лет

№	Публикация
1	Shandrikov M. V., Artamonov I. D., Bugaev A. S., Oks E. M., Oskomov K. V., Vizir, A. V., Deposition of Cu-films by a planar magnetron sputtering system at ultra-low operating pressure. Surface and Coatings Technology, 389, 125600, 2020.
2	Shandrikov M. V., Artamonov I. D., Bakeev I. Y., Bugaev A. S., Oks E. M., Vizir A. V., Yushkov G. Y., Planar magnetron discharge with confinement of injected electrons.

	Vacuum, 192, 110487, 2021.
3	Shandrikov M. V., Bugaev A. S., Gushenets V. I., Oks E. M., Savkin K. P., Vizir, A. V., Deposition of tungsten disilicide films by DC magnetron sputtering at ultra-low operating pressure. Surface and Coatings Technology, 422, 127501, 2021.
4	Semenov V. A., Oks E. M., Solovyev A. A., Shandrikov M. V., Ionization of copper in gas and gasless modes of continuous high-power magnetron sputtering. Vacuum, Vol. 230, P. 113649, 2024.
5	Shandrikov M. V., Oks E. M., Oskirko V. O., Cherkasov, A. A., Vacuum (gasless) DC magnetron discharge with a cold planar target-cathode. Pisma v Zhurnal Tekhnicheskoi Fiziki, 49(22), 19-22, 2023.
6	Oskirko V. O., Shandrikov M. V., Pavlov A. P., Zakharov A. N., Azhgikhin M. I., Solovyev A. A., The dynamics of the electron temperature and density in short-pulse HiPIMS discharge. Vacuum, 230, 113672, 2024.
7	Vizir A. V., Oks E. M., Shandrikov M. V., Yushkov G. Y., Generation of a Metal Ion Beam Using a Vacuum Magnetron Discharge. Plasma, 4(2), 222-229, 2021.
8	Tyunkov A.V., Burdovitsin V. A., Oks E. M., Shandrikov M. V., Yushkov Y. G., Zavadsky S. M., Zolotukhin D. B., Mass-to-charge ion composition of plasma in a magnetron discharge with reactive sputtering of titanium target. Plasma Processes and Polymers, 18(3), 2000210, 2021.
9	Золотухин Д. Б., Шандриков М. В., Юшков Г. Ю., Ионный состав плазмы планарного магнетрона в газовом и вакуумном режимах функционирования. Прикладная физика, № 1., С. 16-23, 2025.
10	Shandrikov M. V., Vizir A. V., Bugaev A. S., et al., Axial Distribution of the Ion Mass-to-Charge State in a Magnetron Discharge Plasma. Russian Physics Journal, Vol. 62, No. 11, P. 1993-1997, 2020.

Научный руководитель, к.т.н. Шандриков М.В.

29.09.2025 г.

Подпись Шандрикова М.В. удостоверяю,

Зам. директора ИСЭ СО РАН, к.ф.-м.н. Батраков А.В.